(12)公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2005-534145 (P2005-534145A)

(43) 公表日 平成17年11月10日(2005.11.10)

(51) Int.C1. ⁷	F I		テーマコード(参考)
HO5B 33/22	HO5B 33/22	Z	3 K O O 7
HO5B 33/12	HO5B 33/12	В	
HO5B 33/14	HO5B 33/14	А	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 14 頁)

 (21)出願番号 (86)(22)出願日 (85)翻訳文提出日 (86)国際出願番号 (87)国際公開番号 (87)国際公開日 (31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国 	特願2004-522616 (P2004-522616) 平成15年7月8日 (2003.7.8) 平成16年11月30日 (2004.11.30) PCT/1B2003/003014 W02004/009729 平成16年1月29日 (2004.1.29) 02077998.9 平成14年7月23日 (2002.7.23) 欧州特許庁 (EP)	(71) 出願人	590000248 コーニンクレッカ フィリップス エレク トロニクス エヌ ヴィ Koninklijke Philips Electronics N. V. オランダ国 5621 ベーアー アイン ドーフェン フルーネヴァウツウェッハ 1 Groenewoudseweg 1, 5 621 BA Eindhoven T
			621 BA Eindhoven, T
			he Netherlands
		(74)代理人	100087789
			弁理士 津軽 進
		(74)代理人	100114753
			弁理士 宮崎 昭彦
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】エレクトロルミネセントディスプレイ及びこのようなディスプレイを有する電子デバイス

(57)【要約】

本発明は、基板に形成された第1のディスプレイピクセ ル及び第2のディスプレイピクセルを有するエレクトロ ルミネセントディスプレイに関する。ディスプレイピク セルは、前記基板上に又は前記基板を覆って堆積された 第1の電極と、エレクトロルミネセント層と、第2の反 射電極とを有する第1の及び第2のディスプレイピクセ ルは、少なくとも1つの絶縁構造を有する領域によって 分離される。前記絶縁構造は、前記第2の反射電極で反 射された前記第2のディスプレイピクセルにおける光の 出力を抑制するように適応され、前記光は、少なくとも 前記第1のディスプレイピクセル及び/又は前記基板か ら入射する。絶縁構造は、第1のディスプレイピクセル と第2の又は他のディスプレイピクセルとの間の光のク ロストークを低減し、エレクトロルミネセントディスプ レイの製造工程に容易に組み込まれることができる。



(19) 日本国特許庁(JP)

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板に形成された第1のディスプレイピクセル及び第2のディスプレイピクセルを少な くとも有するエレクトロルミネセントディスプレイであって、前記第1の及び第2のディ スプレイピクセルは、少なくとも、

- 前記基板上に又は前記基板を覆って堆積された第1の電極と、

- エレクトロルミネセント層と、

- 第2の反射電極と、

を有し、前記第1のディスプレイピクセル及び前記第2のディスプレイピクセルは、少な くとも1つの絶縁構造を有する領域によって分離される、エレクトロルミネセントディス プレイにおいて、前記絶縁構造は、前記第2の反射電極で反射された前記第2のディスプ レイピクセルにおける光の出力を抑制するように適応され、前記光は、少なくとも前記第 1のディスプレイピクセル及び/又は前記基板から入射する光から生じることを特徴とす るエレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項2】

請求項1に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前 記第2のディスプレイピクセルの近くに又は前記第2のディスプレイピクセルに沿って少 なくとも1つの縁を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【 請 求 項 3 】

請求項2に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記縁は、前記第2 20 のディスプレイピクセルに対して角度 を有する少なくとも1つの傾斜した側壁を有する 、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項4】

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記角度 は、(2^{m a ×} + 2^{m i n})/2より大きく、ここで、 2^{m a ×} 及び 2^{m i n} は、それぞれ、前記基板と前記絶縁構造との界面における屈折の最大及び最小角である、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項5】

請求項3又は4に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記角度 は 、図4-Aに従って所望の視角 ₅に依存するように選択される、エレクトロルミネセン 30 トディスプレイ。

【請求項6】

請求項3、4又は5に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記角度 は40°より大きい、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項7】

請求項1に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、2 .0以上の屈折率を持つ材料で作られる、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項8】

請求項7に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、T iO₂又はSnO₂を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項9】

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前記傾斜した側壁の粗い表面を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項10】

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は湾曲 した側壁を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項11】

請求項1又は2に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造 は吸光粒子を有する、エレクトロルミネセントディスプレイ。

【請求項12】

40

請求項3に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、前記傾斜した側壁の下に適切に堆積された吸光グリッドを有する、エレクトロルミネセント ディスプレイ。

【 請 求 項 1 3 】

請求項1又は2に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造 は、前記第2の反射電極を部分的に置換する吸光材料を有する、エレクトロルミネセント ディスプレイ。

【請求項14】

請求項1に記載のエレクトロルミネセントディスプレイにおいて、前記絶縁構造は、請 求項1乃至13の何れかの組合せに従って適応される、エレクトロルミネセントディスプ 10 レイ。

【請求項15】

請求項1乃至14の何れか1項に記載のエレクトロルミネセントディスプレイを有する 電子デバイス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

本発明は、基板に形成された第1のディスプレイピクセル及び第2のディスプレイピク セルを少なくとも有するエレクトロルミネセントディスプレイであって、前記第1の及び 第2のディスプレイピクセルは、少なくとも、

20

- 前記基板上に又は前記基板を覆って堆積された第1の電極と、

- エレクトロルミネセント層と、

- 第2の反射電極と、

を有し、前記第1のディスプレイピクセル及び前記第2のディスプレイピクセルは、少な くとも1つの絶縁構造を有する領域によって分離される、エレクトロルミネセントディス プレイに関する。本発明は、更に、このようなエレクトロルミネセントディスプレイを有 する電子デバイスに関する。

【背景技術】

[0002]

米国特許第5,989,785号は、2つの電極間に挟まれたルミネセント領域を有す 30 る基板上に形成されたディスプレイピクセルを有するエレクトロルミネセントデバイスを 開示する。ルミネセント領域の光出力は、他のルミネセント領域の光出力によって影響さ れうる(即ち光のクロストーク)。ルミネセント領域間の光のクロストークは、誘電体膜 によってルミネセント領域を絶縁することによって最小化される。薄膜の屈折率は、ルミ ネセント領域から入射する光を同じルミネセント領域に全反射して戻すように選択される

[0003]

しかし、多くの例において、従来技術のエレクトロルミネセントディスプレイのディス プレイピクセル間の光のクロストークは、依然として明らかである。光のクロストークは 、最終的には、エレクトロルミネセントディスプレイ上でゴーストイメージの存在をもた らしうる、即ち、個々のディスプレイピクセルが、ディスプレイ制御手段によって活性化 されていないのに「オン」であるように見える。更に、ディスプレイピクセルの構造を適 応させることによってクロストークを最小化する試みは、多くの追加の製造ステップをも たらした。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

本発明の1つの目的は、隣接したピクセルから放射される光及び / 又はディスプレイの 外部からの周辺光に起因するディスプレイピクセル間の光のクロストークを大幅に低減す るエレクトロルミネセントディスプレイを提供することである。

50

【課題を解決するための手段】

[0005]

この目的は、前記絶縁構造が、前記第2の反射電極で反射された前記第2のディスプレ イピクセルにおける光の出力を抑制するように適応され、前記光は、少なくとも前記第1 のディスプレイピクセル及び / 又は前記基板から入射することを特徴とするエレクトロル ミネセントディスプレイを提供することによって達成される。 【0006】

この絶縁構造は、前記第2の反射電極における反射の結果としてのディスプレイピクセル間の光のクロストークを抑制、低減又は解消しさえし、これにより、エレクトロルミネセントディスプレイ上のゴーストイメージの可能性を低下させる。 【0007】

本発明の好適な実施例において、前記絶縁構造は、前記第2のディスプレイピクセルの 近くに又は前記第2のディスプレイピクセルに沿って少なくとも1つの縁を有する。この ような縁は、例えば、絶縁層に形成された孔へのディスプレイピクセルの収容によって作 製されることができる。この実施例は、このような絶縁構造の作製が、前記エレクトロル ミネセントディスプレイの製造工程に追加のステップをもたらさないという利点を有する 。絶縁構造は、ディスプレイピクセルに対して角度 を有する、前記ディスプレイピクセ ルのうちの少なくとも1つに向けて傾斜している側壁を示してもよい。傾斜した側壁と基 板との角度を慎重に選択することにより、第2の電極を介したディスプレイピクセル間の 光のクロストークは、所望の視角に応じて、効果的に抑制されることができる。好適な実 施例においては、角度 は40°よりも大きい。なぜならこの場合、光のクロストークは 、全視角について実質的に抑制されるからである。

[0008]

本発明の好適な実施例において、絶縁構造は、少なくとも部分的に、高い屈折率を有す る材料から作られる。絶縁構造は、好適にはTiO₂又はSnO₂から作られる。より高 い屈折率を有するこのような誘電体絶縁層によって従来型の誘電層を置換することは、デ ィスプレイピクセル間の光のクロストークが抑制されると同時に、このようなエレクトロ ルミネセントデバイスに追加の製造ステップをもたらさない。

【0009】

本発明の好適な実施例において、絶縁構造の傾斜した側壁は、粗い表面又は湾曲面を有 30 する。このような構造は、容易に得られることができ、且つ、エレクトロルミネセントデ ィスプレイのディスプレイピクセル間の光のクロストークを低減することの効果的な方法 を提供する。

絶縁構造の側壁の角度、材料又は表面を適応させること以外には、ディスプレイピクセ ル間の光のクロストークを防止するために、吸光手段も用いられることができる。本発明 の好適な実施例において、絶縁構造は吸光粒子を有する。更に、吸収グリッド(例えば黒 いマトリクス)が、絶縁層の傾斜側壁の下に堆積されることができる。また、第2の電極 が部分的に除去されて、吸光材料によって置換されることができる。吸光材料を有する実 施例は、製造に関して単純であり、エレクトロルミネセントディスプレイのディスプレイ ピクセル間の光のクロストークの効果的な抑制を提供する。

【 0 0 1 1 】

米国特許第6,901,195号は、エレクトロルミネセントディスプレイの種々のデ バイス間の光のクロストークを低減するためのリフレクタを有するエレクトロルミネセン トディスプレイを開示する。このようなエレクトロルミネセントディスプレイの製造は、 複雑であり、本発明によるエレクトロルミネセントディスプレイと比較して、追加のプロ セスステップ及び部品を必要とする。

【0012】

言うまでもなく、本発明の前述の実施例又は前述の実施例の側面が組み合わせられることができる。

10

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

本発明の実施例が、添付の図面を参照してより詳細に説明される。

図1は、従来型のアクティブマトリクスルミネセントディスプレイの断面の一部である (一定比率ではない)。このアクティブマトリクスディスプレイは、第1の電極2、絶縁 層3、有機発光層4及び第2の電極5を持つ基板1を有する。この構成において、エレク トロルミネセントディスプレイは、行及び列に配列される種々のディスプレイピクセル6 、7を示す。エレクトロルミネセントディスプレイ及び/又はディスプレイピクセルは、 金属層(例えばキャパシタを提供するため)、他の絶縁層(例えばクロスオーバーを規定 するため)及び半電導性層(例えば薄膜トランジスタを提供するため)等の追加の幾つか の層を有してもよい。

(5)

【0015】

基板1は、好適にはガラス又はプラスチック等の透明材料でできている。基板の厚さは 、 例 え ば 7 0 0 μ m で あ る 。 透 明 基 板 1 は 、 少 な く と も デ ィ ス プ レ イ ピ ク セ ル 6 、 7 が 収 容されるべき部位においては第1の電極2によってカバーされる。第1の電極2は、スパ ッタリング等の堆積プロセスによって基板上に形成される。これらの第1の電極2は、ル ミネセント層4において生成される光に関して好適には透明である。一般的に、これらの 第1の電極2はインジウムスズ酸化物(ITO)から作られるが、異なった伝導性透明材 料、例えば伝導ポリマー(ポリアニリン(PANI)又はポリ-3,4-エチレンジオキ シチオフェン(PEDOT))も利用可能である。エレクトロルミネセントディスプレイ の 製 造 の 間 、 (誘 電 体) 絶 縁 層 3 が 、 第 1 の 電 極 2 の 上 に 堆 積 さ れ 、 続 い て 、 ディ ス プ レ イピクセル6及び7が形成されるべき部位においては除去される。この例では、誘電体絶 縁層3は、SiNでできており、0.5µmの厚さを有する。実際、絶縁層3は、これら のディスプレイピクセルの方向へ傾斜している側壁8、9を示す当該絶縁層における孔の 形成によって、ディスプレイピクセル6及び7を分離する。ディスプレイピクセル6、7 の幅は、例えば50μmであり、これらディスプレイピクセルは、30μmの距離に亘る 領域によって分離され、この領域のうち、傾斜側壁8、9がそれぞれ5μmを占める。絶 縁層3は、第1の電極2との電気接触が確立されることができれば、傾斜側壁8の隣の第 1の電極2の端に沿って延在してもよいことに注意されたい。従って、この場合、絶縁層 又は構造3の幅は、ディスプレイピクセル6と7との分離領域の幅より大きい。第1の電 極2又は絶縁層3は、エレクトロルミネセント層4又はエレクトロルミネセント材料(例 えばポリ-p-フェニレン(PPV)等の特定の有機材料又はその誘導体)を有する層に よってカバーされる。エレクトロルミネセント層4は、真空蒸着、化学蒸着、又は、スピ ンコーティング、ディップコーティング若しくはインクジェットプリンティング等の液体 を用いる技術を用いて堆積することができる。エレクトロルミネセント層4は、少なくと もディスプレイピクセル6、7が形成されるべき部位において第2の電極5によってカバ -される。第2の電極は、金属であり、高度に反射性である。 [0016]

図1は、アクティブマトリクスモノクロエレクトロルミネセントディスプレイの断面で 40 あるが、本発明及びその利点は、パッシブマトリクスエレクトロルミネセントディスプレ イ、セグメントディスプレイ及びカラーディスプレイに同等に適用可能であることに注意 されたい。パッシブマトリクスディスプレイにおいては、ディスプレイピクセルは、通常 フォトレジスト層又は構造によって分離される。下記において、本発明の実施例は、図1 に示されたようなモノクロアクティブマトリクスディスプレイに関して詳細に説明される

[0017]

図1に示されるエレクトロルミネセントディスプレイを動作する際に、ディスプレイ制 御手段(図示せず)によって電圧が種々のディスプレイピクセル6、7に印加されること ができる。電圧が電極2、5に印加されなければ、光はルミネセント層4では生成されず

10

20

30

、ピクセルは「オフ」であり、これは図1のピクセル7について当てはまる。電圧がルミ ネセント層4に印加されると、光がこの層4において生成される、即ち、ピクセルは「オ ン」であり、これはピクセル6について当てはまる。この光は透明な第1の電極2及び透 明基板1を通じてディスプレイピクセル6から大気中に出て、結果として、光線10によ って示されるように、ディスプレイピクセル6の直接像が得られる。 【0018】

(6)

ディスプレイピクセル 6 で生成される光は、ランバート的に(Lambertianally)放出さ れる、即ち、発光は各方向に等しく分散される。従って、一部の光は、光線11によって 示されるように基板1を横断する。これらの光線11は、基板-空気界面で、内部反射さ れ(TIR)、続いて、隣接したディスプレイピクセル7に通じる(即ちクロストーク) 。図1に示されるように、光線11~は、これらの光線11~に対して鏡として動作する 第2の反射電極5で反射される。次に反射光線11は、第2の反射電極5の傾きのため光 線11~~としてディスプレイピクセル7を出て、結果としてディスプレイピクセル7の 画像を生じさせる。第2の電極5の傾きは、ディスプレイピクセル6、7を収容するため の絶縁層3の孔の傾斜側壁8、9による。このように、ディスプレイピクセル7が「オフ 」であるのに、「オン」のピクセルで発生してエレクトロルミネセントディスプレイ内で 反射した光のクロストークのため、このピクセル7の画像が存在する。この画像は、以下 ではゴーストと呼ばれる。このようなゴーストイメージは、エレクトロルミネセントディ スプレイの外部で生じて(即ち周辺光)、第2の電極5によって反射される光からも生じ うる。ディスプレイピクセル6、7間の光のクロストークは、視角に依存する低減された コントラストを生じ、また、種々のカラー(RGB)ディスプレイピクセルからの光の混 合のためにカラーディスプレイの変色が生じうる。

【0019】

図2は、エレクトロルミネセントディスプレイが、第2の電極5の光の反射に起因する ディスプレイピクセル6、7間の光のクロストークを抑制するように適応された絶縁構造 を有する、本発明の種々の実施例を示す。言うまでもなく、ディスプレイピクセルは、図 1に示されているように互いと隣接していなければならないわけではない。光11は、更 に遠くにある、即ち第2のディスプレイピクセル7に隣接していない、1つ又は複数のデ ィスプレイピクセルから、上記光に加えて又は単独で生じうる。

[0020]

図2 - Aは、絶縁層3の傾斜側壁8が、該傾斜側壁8によって基板1の表面に対して形成される角度 に関して適切に成形されている、好適な実施例を示す。以下に説明されるように、実際の状況では、40°を超える角度 は、全視角において、ディスプレイピクセル7からのゴーストイメージを生じさせる光線11'の第2の電極5からの所望されない反射を実質的に解消又は低減することが分かっている。この実施例は、更に詳細に説明される。

図2 - Bは、絶縁層3が十分に高い屈折率を有する本発明の好適な実施例を示す。例えば、この誘電層のためにTiO2(n=2.5)又はSnO2(n=2)が用いられてもよい。高い屈折率は、基板1と絶縁層3との界面における増加された屈折を生じさせ、これにより、ディスプレイピクセル6、7間の光のクロストークを効果的に抑制する。 【0022】

図2 - Cは、絶縁層3の傾斜側壁8の表面12が粗くなった本発明の好適な実施例を示 す。このような粗面化は、反応性イオンエッチング(RIE)によって容易に得ることが できる。代替的に、粗い表面12は、幅が減少する種々の薄い絶縁層を基板1と平行に堆 積させ、ステップ状の絶縁層3を得ることによって得られることができる。このような方 法のRIEに勝る利点は、絶縁層3におけるピンホールの回避である。傾斜側壁8の粗い 表面12の効果は、基板 - 空気界面からのTIR光11'が第2の電極5によって反射さ れる代わりに拡散されるということであり、結果として、ディスプレイピクセル7のゴー ストイメージの光量11''のかなりの減少が得られる。 10

20

30

【0023】

図2 - Dは、絶縁層3の側壁の表面13が適切に凸状に湾曲させられ、ディスプレイピクセル7への光のクロストークが防止される、本発明の好適な実施例を示す。側壁13の 湾曲は、絶縁層3の等方性エッチングによって得られることができる。 【0024】

(7)

図2 - A ~ 2 - Dにおいて、絶縁構造は、絶縁層3(の一部)の形状又は材料に調整を 加えることにより実現される。これらの調整は、エレクトロルミネセントディスプレイの 製造工程において非常に容易に実現されることができる。なぜなら、追加のプロセスステ ップがほとんど又は全く必要とされないからである。これらの絶縁構造は、他のディスプ レイピクセル6からの光又は周辺光によるディスプレイピクセル7のゴーストイメージの 出現を抑制する効果的な手法を提供する。ディスプレイピクセル6、7のコントラストは 最適であり、カラーディスプレイの変色は解消される。 【0025】

種々のディスプレイピクセル6、7間のクロストーク又は周辺光の影響の効果的な消去 に対する第2のアプローチは、吸光材料の適用に関する。この方法の種々の実施例は、図 2 - E ~ 2 - Gに示される。

[0026]

図2 - Eは、絶縁層3が炭素粒子等の吸光粒子を有する本発明の好適な実施例を示す。 吸光粒子は、TIR光線11'が、第2の電極5における反射の前又は後にこれら粒子に よって吸収され、この結果、実質的に光11''が絶縁層3を出ないので、効果的なクロ ストーク防止手段を提供する。

20

10

【 0 0 2 7 】

図2 - Fは、吸収グリッド14(即ち黒いマトリクス)が、絶縁層3の傾斜側壁8の下 に適用された、本発明の好適な実施例を示す。TIR光線11 'は、黒いマトリクス14 によって、光線11 ''として絶縁層3に入る又は絶縁層3から出ることを防止されるの で、ディスプレイピクセル6、7間のクロストークは、抑制され又は最適には解消される

[0028]

最後に、図2-Gは、第2の反射電極5が、絶縁層3の傾斜側壁の上で部分的に除去された、本発明の好適な実施例を示す。言うまでもなく、ディスプレイピクセル6、7に対 30 する電圧の印加は依然として可能であるべきである。好適には、絶縁層のむきだしの部分は、吸収材料15によってカバーされる。本実施例において、鏡として動作する第2の電極5の影響はかなり低減され、この結果、ディスプレイピクセル6、7間のクロストークは低減される。

【0029】

図3は、図2-Aを参照する3つの場合A~Cを示し、ここで、絶縁層3の傾斜側壁8 の角度 が変化される。 2 は、基板1と絶縁層3との界面におけるTIR光線11'の 屈折角である。角 5 は、基板1の垂線に対する視角を示す。Aでは、0 < < 2 / 2 且つ 5 > 0 である場合が示され、Bでは、 2 / 2 < < 2 且つ 5 < 0 である場合 が示され、Cでは、 > 2 で光出力が存在しない場合が示される。 【0030】

基板 - 空気界面における全反射のためには 1^{1 i m} < 1 < 90°及び 4^{1 i m} < 4 < 90°が成り立たなければならないので、スネルの法則の適用は、種々のディス プレイピクセル6、7間の光のクロストークを防止するように、絶縁層3の傾斜している 側壁8の最小角 について式 > 1 i m = (2^{m a ×} + 2^{m i n}) / 2を得る。 2^{m a ×}及び 2^{m i n} は、それぞれ、光11の入射の最大及び最小角度 1に関する基 板1と絶縁層3との界面における屈折の最大及び最小角度である。これは、空気について は屈折率n = 1、ガラス及びSiO2により構成された基板1については屈折率n = 1. 5、絶縁層3についてはn = 2とすると、結果として、傾斜側壁8について約39°の最 小角 1 i m を生じる。

20

【0031】

図 2 - Aの実施例の他の分析は、図 4 - A及び 4 - Bに示されるグラフを得る。図 4 -Aは、ディスプレイからゴーストイメージが特定の視角 5 で生じる角度 の範囲 R を示 す。絶縁層 3 の傾斜壁についての 4 0 °を超える角度 は、第 2 の電極で非所望の反射を 回避して、いかなる視角 5 でもゴーストイメージが生成されないようにするのに十分で ある。図 4 - Bは、グラフ(A)、(B)及び(C)が図 3 に示される A ~ Cのケースに 対応する、この結果の代替表現を提供する。

【0032】

本発明を教示するために、ディスプレイ装置の好適な実施例及びこのようなディスプレ イ装置を有する電子デバイスが上記で説明された。当業者には、本発明の他の代替例及び 10 透過の実施例が、本発明の真の精神から逸脱することなく考えられ、実施されることがで きることは明らかであり、本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定される。 【図面の簡単な説明】

【 0 0 3 3 】

【図1】従来型のアクティブマトリクスエレクトロルミネセントディスプレイの断面であ る。

【図2-A】本発明の実施例を示す。

- 【図2 B】本発明の実施例を示す。
- 【図2-C】本発明の実施例を示す。
- 【図2-D】本発明の実施例を示す。
- 【図2-E】本発明の実施例を示す。
- 【図2-F】本発明の実施例を示す。
- 【図2-G】本発明の実施例を示す。
- 【図3】図2-Aに示される本発明の実施例を示す。

【図4-A】図2-Aに示される本発明の実施例について実行される計算の結果を示す。

【図4-B】図2-Aに示される本発明の実施例について実行される計算の結果を示す。





【図3】







【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH REPOR	PCT/IB 03/03014			
a. class IPC 7	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C09K11/06 H01L51/30 H05B33/08				
According t B. FIELDS	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
Minimum di IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classifica CO9K HO1L HO5B	tion symbols)			
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are incl	luded in the fields searched		
Electronic d EPO-In	lata base consulted during the international search (name of data b terna]	ase and, where practica	al, search lerms used)		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.		
x	US 5 989 785 A (INOGUCHI KAZUHIR 23 November 1999 (1999–11–23) cited in the application figures 1–6 example 1	O ET AL)	1-15		
x	US 5 703 436 A (FORREST STEPHEN 30 December 1997 (1997-12-30) figures 1A-C figures 2A-C claims 1-29	R ET AL)	1-15		
X	WO DO 70690 A (STURT CLIFFORD MA TAKEO (GB); SEIKO EPSON CORP (JP 23 November 2000 (2000-11-23) the whole document	RK ;KAWASE))	1–15		
		-/			
X Funt	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family	members are listed in annex.		
 Special ca A' docume consid E' earlier of filing di 'L' docume which citation O' docume later tr Date of the a 	 * Special categories of cited documents : *A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance to be of particular relevance invention at filing date. *E' earlier document but published on or after the international filing of the understand the principle or theory underlying the invention. *C' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other repeating to an oral disclosure, use, exhibition or other means. *D' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed. *C' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed. *C' document member of the actual completion of the international search report. *C' document members 2003 				
Name and n	nalling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5918 Patentlaan 2 NL - 2260 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, TX. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Saldamli, S			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	PCT/IB 03/03014				
C.(Continu	C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Х	US 5 034 192 A (KITTLESEN GREGG P ET AL) 23 July 1991 (1991-07-23) figures 2,4A,6,7	1–15				

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

				,		- <u></u>
INTERNA		SEARCH RE	PORT		PCT/IB	03/03014
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	1	Publication date
US 5034192	A		AU AU AU CA CA DE DP JP JP US US US	60505 478799 58992 503068 124341 126015 358809 018594 207345 709505 6201115 493695 492931 471767	7 B2 0 A 10 B2 15 B2 9 A1 9 A2 9 A1 9 A2 8 D1 1 A2 6 C 2 B 9 A 6 A 3 A 3 A	$\begin{array}{c} 03-01-1991\\ 10-05-1990\\ 26-10-1989\\ 05-06-1986\\ 18-10-1988\\ 26-09-1989\\ 15-05-1996\\ 02-07-1986\\ 25-07-1996\\ 11-10-1995\\ 20-01-1987\\ 26-06-1990\\ 29-05-1990\\ 05-01-1988 \end{array}$
	(002)					
our no morezhe (patent temily annex) (July 1	i rrati					

フロントページの続き

(81)指定国 AP(GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT, BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA, GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ, EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,M W,MX,MZ,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA ,ZM,ZW

(74)代理人 100122769

- <u> 弁理士</u> 笛田 秀仙
- (72)発明者 ジラルド アンドレア
- オランダ国 5656 アーアー アインドーフェン プロフ ホルストラーン 6 (72)発明者 ジョンソン マーク ティー
- オランダ国 5656 アーアー アインドーフェン プロフ ホルストラーン 6 Fターム(参考) 3K007 AB17 BA06 DB03